

最新エネルギー技術の導入でCO₂を大幅削減

CO₂の排出量削減は、私たち富士通セミコンダクターグループにとっても極めて重要な経営課題です。しかし、簡単にできて効果の大きな施策となると、製造業の世界では過去からさまざまな施策を継続して進めてきていることもあり、「やり尽くした……」といった心の中の壁が迫っているのも事実です。そこで私たちは、これまで必須だと思われていたある設備をまったく別のものに置き換える発想の転換を行い、その壁を打ち破ることに成功しました。

半導体プロセスの難敵「瞬時電圧低下」を乗り越えて

これまでの半導体工場に必須だったコ・ジェネレーションシステム。このシステムは、半導体工場の難敵、瞬時電圧低下から工場の製造ラインを守るためのものです。落雷が発生したときに送電線へ与える瞬間的な電圧低下は、製造設備をダウンさせたり、不良品の発生を招いたりします。

これまでは、コ・ジェネレーションシステムによる自家発電により工場ラインを守ってきましたが、昨年度、代替機として富士通セミコンダクター岩手工場と富士通セミコンダクターテクノロジー（福島県）に電気二重層キャパシタを導入しました。



電気二重層キャパシタ

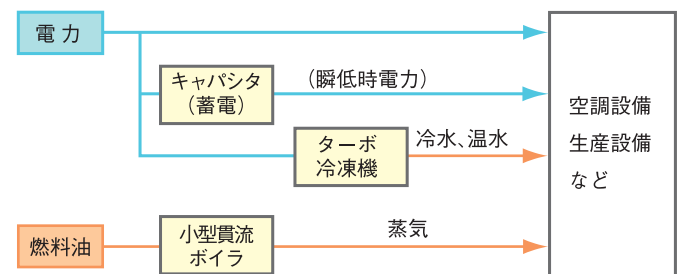
CO₂を大幅削減 富士通グループ環境貢献賞で「環境奨励賞」を受賞

電気二重層キャパシタの導入により、これまでコ・ジェネレーションシステムが供給していた蒸気はなくなりましたが、冷凍機は蒸気を必要としない高効率ターボ冷凍機に置き換え、蒸気使用量が減ったことで、エネルギー効率の高い小型貫流ボイラーに置き換えられました。こうした熱源システム全般の見直しにより、2拠点で年間38,000トンものCO₂の発生量を削減することに成功しました。

そして、6月の環境月間に発表された富士通グループ環境貢献賞のコンテストでは、その成果が認められて「環境奨励賞」を受賞しました。

システムの概要イメージ

<変更後>



<従来>

